# Лазерное спекание нанопористой пленки TiO<sub>2</sub> на гибкой подложке для применения в солнечных элементах

#### © С.П. Малюков, А.В. Саенко, И.А. Кириченко

Институт нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета, 347928 Таганрог, Россия

E-mail: avsaenko@sfedu.ru

(Получена 8 февраля 2016 г. Принята к печати 24 марта 2016 г.)

Рассматривается селективное лазерное спекание наночастиц пленки TiO<sub>2</sub> на пластиковой проводящей подложке для применения в гибких сенсибилизированных красителем солнечных элементах. Показано, что при лазерном спекании поглощенная энергия лазерного излучения способствует созданию электрического контакта между наночастицами TiO<sub>2</sub>, не повреждая пластиковую проводящую подложку. Выбор ближнего инфракрасного лазерного излучения (длина волны 1064 нм) обусловливает эффективность процесса лазерного спекания. Метод лазерного спекания способствует снижению рекомбинационных потерь в пленке TiO<sub>2</sub> и улучшению эффективности собирания зарядов, что может привести к увеличению коэффициента полезного действия данных солнечных элементов. К тому же эффективный метод лазерного спекания имеет большой потенциал для использования в рулонной технологии производства высокоэффективных гибких солнечных элементов.

#### 1. Введение

Разработка гибких тонкопленочных солнечных элементов на металлических или пластиковых проводящих подложках является одной из основных тенденцией современного развития фотоэлементов [1,2]. По сравнению с обычными "жесткими" фотоэлементами, гибкие солнечные элементы обладают следующими преимуществами:

 малый вес и гибкость делают фотоэлементы более пригодными для портативных источников питания;

 способность принимать различные формы способствует развитию встраивания и размещения фотоэлементов на сложных поверхностях, таких как крыши зданий, фасады, а также одежда и аксессуары;

 совместимость с рулонной технологией приводит к дальнейшему укреплению преимущества, связанного с низкой стоимостью и малым сроком окупаемости.

Сенсибилизированные красителем солнечные элементы (СКСЭ) на основе  $TiO_2$  являются одной из наиболее перспективных фотоэлектрических технологий, а возможность изготовления их на гибкой подложке привлекает все большее внимание [1-3]. В качестве гибкой подложки могут использоваться металлическая фольга или проводящие пластиковые пленки, такие как покрытый оксидом индия-олова (ITO) полиэтилентерефталат (PET) или покрытый ITO полиэтиленнафталат (PEN). Металлические подложки для СКСЭ имеют существенный недостаток, связанный с их непрозрачностью, который требует освещения фотоэлемента с тыльной стороны, приводя к нежелательному поглощению света противоэлектродом и электролитом [4]. В данной работе основное внимание уделяется гибким проводящим пластиковым подложкам.

В настоящее время коэффициент полезного действия (кпд) гибких СКСЭ на основе  $TiO_2$  на пластиковых подложках составляет около 7-8% [1], что несколько

ниже, чем 11-12% [3] для "жестких" СКСЭ на FTO (оксид олова, легированный фтором)/стекле. Различия по кпд в основном связаны с невозможностью осуществления высокотемпературного спекания (450-550°C) наночастиц в пленке TiO<sub>2</sub> на пластиковой подложке, которое применяется для пленки TiO<sub>2</sub> на FTO/стекле. Процесс высокотемпературного спекания необходим для удаления органических добавок, содержащихся в пасте TiO<sub>2</sub>, наносимой на подложку, и достижения наилучшего электрического контакта между наночастицами TiO<sub>2</sub> [4]. Морфология спеченной нанопористой пленки TiO<sub>2</sub> (фотоэлектрод) существенно влияет на фотоэлектрические характеристики солнечного элемента, поскольку она служит источником большой удельной площади поверхности для сенсибилизирующих молекул красителя и средой переноса фотогенерированных электронов к коллекторному (собирающему) слою ІТО или FTO [5-8]. Широко используемые пластиковые подложки ІТО-РЕТ или ITO-PEN выдерживают термическую обработку до 120 или 150°С [4]. При такой низкой температуре необходимы дополнительные технологические процессы, позволяющие улучшить электрический контакт между наночастицами TiO2. Для этого исследовались различные методы низкотемпературной обработки, такие как прессование, ультрафиолетовое озонирование, микроволновое спекание, химическое спекание и др. [1,4], которые были бы просты и эффективны для применения в рулонной технологии (roll-to-roll technology) промышленного производства.

В данной работе для получения нанопористой пленки  $TiO_2$  на пластиковой проводящей подложке использовалось селективное лазерное спекание Nd: YAG-лазером с длиной волны 1064 нм. Предполагается, что применение быстрой лазерной обработки пленки  $TiO_2$  позволит улучшить электрический контакт между наночастицами  $TiO_2$ , не приводя к существенному уменьшению удель-

ной площади поверхности пленки  ${\rm TiO}_2$  и не повреждая гибкую ITO/PEN подложку.

### 2. Методика эксперимента

Нанопористая пленка TiO<sub>2</sub> размером  $0.5 \times 0.5$  см формировалась на поверхности ITO/PEN ( $15 \text{ См/см}^2$ ) подложки методом нанесения пасты ракелем ("doctor blade" метод) [5,6,9]. Паста на основе TiO<sub>2</sub> без органического связующего вещества состояла из наночастиц TiO<sub>2</sub> (Degussa P25, средний диаметр частиц 25 нм) и этанола. Перед нанесением паста обрабатывалась на шаровой мельнице со скоростью вращения 500 об./мин. в течение 2 ч. После нанесения пленка TiO<sub>2</sub> сушилась в термошкафу при 120°C в течение 30 мин и спекалась лазерным излучением с длиной волны 1064 нм.

Выбор длины волны 1064 нм лазерного излучения существенно влияет на эффективность спекания пленки TiO<sub>2</sub>. В работах [10-12] показано, что при аналогичном лазерном спекании ультрафиолетовым (УФ) излучением (355 нм) лазерная энергия интенсивно поглощается лишь в очень тонком (100-200 нм) приповерхностном слое пленки TiO<sub>2</sub>, приводя к формированию плотного (не пористого) слоя. Данный слой препятствует адсорбции молекул красителя на поверхности наночастиц TiO2 и проникновению раствора электролита в нанопористую структуру TiO<sub>2</sub>, что делает практически невозможным функционирование солнечного элемента. В свою очередь ближнее инфракрасное (ИК) излучение имеет большую оптическую глубину проникновения в пленку TiO<sub>2</sub>, приводя к более однородному и "мягкому" эффекту спекания пленки по всей толщине (10-15 мкм) [4,6,13]. Это связано с физическими особенностями поглощения ближней ИК области спектра пленкой TiO2. Основной механизм поглощения ИК излучения связан с энергетическими уровнями внутри запрещенной зоны TiO<sub>2</sub>, образованными кислородными вакансиями, и является относительно слабым по сравнению с межзонным поглощением фотонов УФ излучения [14].

В данной работе в качестве источника ближнего ИК лазерного излучения использовался импульсный Nd: YAG-лазер с длиной волны 1064 нм (длительность импульса 84 нс, частота следования импульсов 10 кГц, максимальная энергия в импульсе 110 мДж) универсальной лазерной установки LIMO 100-512/1064-U с компьютерным управлением. Пленка TiO<sub>2</sub> размещалась на трехкоординатном рабочем столике. Энергия в импульсе лазерного излучения устанавливалась на уровне 20 мДж [4,5]. Лазерный луч отклонялся с помощью сканера Scanlab и фокусировался 100 мм F-Theta линзой. Скорость сканирования в фокальной плоскости составляла 10 мм/с, а рабочее расстояние F-Theta линзы — 136.5 мм. Фокус лазерного луча находился на расстоянии 36.5 мм над пленкой TiO2. Площадь воздействия лазерного луча на поверхности пленки TiO2 имела квадратное сечение со стороной 500 мкм. Процесс сканирования пленки  $TiO_2$  лазерным излучением основан на возвратно-поступательном движении с повторяющейся длиной 5 мм и строчным интервалом 250 мкм (50% перекрытие лазерных пятен). Таким образом, для сканирования области размером  $0.5 \times 0.5$  см потребовалось 11 с согласно приведенному выражению

$$t = \frac{\left(\frac{w}{dn} + 1\right)l + w}{V},\tag{1}$$

где t — время сканирования, l — длина пленки, w — ширина пленки, d — диаметр лазерного пятна, n — перекрытие лазерных пятен, V – скорость сканирования.

Для сенсибилизации пленки TiO<sub>2</sub> на ITO/PEN подложках выдерживались в 0.5 ммоль/л растворе красителя N719 в бутаноле и ацетонитриле (объем 1:1) в течение 20 ч при комнатной температуре [4–6].

Таким образом, были получены нанопористые пленки  $TiO_2$  на поверхности ITO/PEN подложки, обработанные и не обработанные лазерным излучением.

## 3. Экспериментальные результаты

Селективность лазерного спекания длиной волны 1064 нм пленки  $TiO_2$  на ITO/PEN подложке достигается за счет различного поглощения излучения в каждом слое. На рис. 1 представлены спектры пропускания структур PEN, ITO/PEN и  $TiO_2/ITO/PEN$ , полученные с помощью спектрофотометра СФ-26. В отличие от слоев PEN и ITO (поглощение 9.7 и 8.3%) пленка  $TiO_2$  поглощает основную часть излучения на 1064 нм (28.5%), и, следовательно, наиболее высокая температура достигается непосредственно в пленке  $TiO_2$ .

Исследование толщины и морфологии поверхности полученных пленок TiO<sub>2</sub> на ITO/PEN пластиковой подложке проводилось методом растровой электронной микроскопии (РЭМ) на микроскопе Nova Nanolab 600.



**Рис. 1.** Спектры пропускания структур PEN, ITO/PEN и TiO<sub>2</sub>/ITO/PEN.

На рис. 2, *а,b* представлены РЭМ-изображения толщины пленки  $TiO_2$  на гибкой подложке до и после лазерного спекания, а также поверхность пленки  $TiO_2$  после лазерного спекания. В результате исследований установлено, что в процессе лазерного спекания пленки  $TiO_2$  длиной волны 1064 нм происходит уменьшение ее толщины, предположительно, за счет внутреннего уплотнения (усадки), связанного со снижением пористости пленки при нагреве лазерным излучением [6,13]. В данном случае использовалась паста  $TiO_2$  без связующих веществ, таких как этилцеллюлоза или полиэтиленгликоль, поэтому изменение толщины не может быть связано с испарением органических веществ. Морфоло-



**Рис. 2.** РЭМ-изображения толщины пленки  $TiO_2$  до (a) и после (b) лазерного спекания; морфология поверхности спеченной пленки  $TiO_2$  (c).



**Рис. 3.** Оптическая прозрачность ITO/PEN подложки до и после лазерного спекания.

гия поверхности пленки  $\text{TiO}_2$  после лазерного спекания не изменялась и по-прежнему состояла из первичных наночастиц диаметром порядка 20-30 нм (рис. 2, *c*), что необходимо для организации большой удельной площади поверхности пленки.

Из работ [7,8,15–17] известно, что уменьшение пористости пленки TiO<sub>2</sub> приводит к образованию между частицами дополнительных электрических контактов, способствующих переносу электронов в пленке TiO<sub>2</sub> и их эффективному собиранию слоем ITO. Соответственно при лазерном спекании сопротивление рекомбинации становится больше, что свидетельствует о значительном снижении обратного переноса электронов через границу ТіО<sub>2</sub>/электролит (увеличивается время жизни электронов в зоне проводимости TiO2 и окисленного состояния компонента электролита [7]), а сопротивление переносу электронов становится меньше вследствие улучшения электрического контакта между наночастицами (возрастает коэффициент диффузии и диффузионная длина электронов в пленке [8,17]). При этом сопротивление переносу электронов лежит в основе последовательного сопротивления в фотоэлементе, а сопротивление рекомбинации — шунтирующего сопротивления. Таким образом, согласно однодиодной модели солнечного элемента, уменьшение последовательного сопротивления и увеличение шунтирующего сопротивления необходимы для улучшения фотоэлектрических характеристик солнечных элементов, в частности увеличения кпд.

После лазерного воздействия на ITO/PEN пластиковую подложку ее параметры, такие как поверхностное сопротивление и оптическая прозрачность, оставались практически постоянными (рис. 3). Измерение спектров пропускания ITO/PEN подложки осуществлялось с помощью спектрофотометра СФ-26. Величина поверхностного сопротивления также практически не изменялась и составляла до и после лазерного спекания 14.8 и 15.6 Ом/см<sup>2</sup> соответственно. Таким образом, лазерное спекание длиной волны 1064 нм не приводит к повреждению пластиковой подложки.

Поскольку при лазерном спекании наблюдается уплотнение пленки TiO<sub>2</sub>, связанное со снижением пористости, что может приводить к ухудшению поглощения солнечного излучения из-за недостаточного количества адсорбированных молекул красителя, необходимо исследовать спектры пропускания сенсибилизированной красителем пленки TiO<sub>2</sub> до и после лазерного спекания [5]. На рис. 4 показаны спектры пропускания сенсибилизированной красителем N719 пленки TiO2 до и после лазерного спекания. Вследствие интенсивного поглощения молекулами красителя видимой области спектра (N719 поглощает излучение до 750 нм) пропускание сенсибилизированной пленки TiO<sub>2</sub> в видимой области практически отсутствует, как до, так и после лазерного спекания. Таким образом, сенсибилизированная красителем пленка TiO<sub>2</sub> после лазерного спекания показывают такое же пропускание, как и не спеченная пленка, что соответствует достаточному количеству адсорбированных молекул красителя на поверхности TiO<sub>2</sub> для эффективного поглощения солнечного излучения.

Влияние лазерного спекания на качественный и количественный состав пленки TiO2 исследовался методом рентгеновской дифракции на установке ДРОН-3. Полученные рентгеновские дифрактограммы пленок TiO<sub>2</sub> до и после лазерного спекания представлены на рис. 5. Известно [10], что наночастицы исходного порошка TiO<sub>2</sub> состоят из порядка 80% кристаллической фазы анатаза и 20% кристаллической фазы рутила. На дифрактограммах пленок TiO<sub>2</sub> присутствуют пики фазы анатаза при угле  $2\theta = 25.4$ , 37.7, 47.9, 55.2°, соответствующие отражению рентгеновского излучения от плоскостей (101), (004), (200), (105) тетрагональной кристаллической структуры анатаза, и пики фазы рутила при угле  $2\theta = 27.4, 36.5, 54.2^{\circ},$  соответствующие отражению от плоскостей (110), (101), (211) тетрагональной кристаллической структуры рутила [18,19].

Представленные результаты показывают увеличение фазы рутила в спеченной лазером пленке TiO<sub>2</sub>, поскольку интенсивность пиков фазы анатаза в спеченной пленке практически аналогична интенсивности в неспеченной, а интенсивность пиков фазы рутила в спеченной пленке значительно возрастает. Таким образом, рентгеновский дифракционный анализ показал наличие фазового перехода анатаза в рутил в процессе лазерного спекания.

Количественный анализ фазового состава пленок TiO<sub>2</sub> (соотношение между фазами анатаза и рутила) определялся с помощью выражения [19]

$$w(A) = \frac{1}{1 + 1.265I_R/I_A} \times 100\%,$$
 (2)

где w(A) — процентное содержание фазы анатаза,  $I_R$ и  $I_A$  — интенсивности дифракционных пиков фаз рутила ( $2\theta = 27.4^\circ$ ) и анатаза ( $2\theta = 25.4^\circ$ ) соответственно.



**Рис. 4.** Спектр пропускания сенсибилизированной пленки TiO<sub>2</sub> до и после лазерного спекания.



**Рис. 5.** Дифрактограммы пленок TiO<sub>2</sub> до и после лазерного спекания (*A* — пики фазы анатаза, *R* — пики фазы рутила).

Содержание кристаллической фазы анатаза в пленке TiO<sub>2</sub> после лазерного спекания сокращается от 79.8 до 68.7%, что также подтверждает наличие фазовых изменений в пленке TiO<sub>2</sub>. При этом известно [3,18], что фазовый переход в пленке TiO2 происходит только при температурах свыше 500-550°С при спекании пленки в муфельной печи в течение нескольких часов. Однако в данной работе фазовый переход был реализован в течение нескольких секунд с помощью лазерного спекания ближним ИК излучением (1064 нм), что свидетельствует о достижении температуры 500°С в пленке ТіО2. Кроме того, быстрый фазовый переход в результате лазерного спекания не приводит к росту размера наночастиц TiO<sub>2</sub> (рис. 2) и сохраняет высокое содержание молекул красителя на поверхности пленки  $TiO_2$  (рис. 4). Высокая скорость и отсутствие негативных изменений в морфологии пленки TiO<sub>2</sub> являются основными преимуществами метода селективного лазерного спекания.

## 4. Заключение

В данной статье исследовано применение селективного лазерного спекания при формировании пленки TiO<sub>2</sub> на проводящих пластиковых подложках для применения в высокоэффективных гибких СКСЭ. Показано, что лазерное спекание позволяет эффективно спекать наночастицы пленки TiO2, не изменяя морфологию поверхности пленки TiO<sub>2</sub> и не приводя к повреждению пластиковой подложки. Лазерное спекание способствует улучшению электрического контакта между наночастицами TiO<sub>2</sub> за счет частичного фазового перехода анатаза в рутил, а также образованию большего количества путей для переноса электронов в пленке TiO<sub>2</sub> вследствие уменьшения ее пористости. Эффект возрастания температуры в пленке TiO<sub>2</sub> при лазерном спекании также приводит к очистке поверхности наночастиц TiO2 за счет удаления некоторых нежелательных адсорбентов и оборванных связей в кристаллах ТіО2, которые приводят к рекомбинационным потерям в солнечном элементе. К тому же лазерное спекание является быстрым процессом: эффективное время спекания резко сокращается с нескольких часов в муфельной печи до нескольких секунд. Таким образом, лазерное спекание потенциально может способствовать улучшению характеристик гибких СКСЭ на основе TiO2. Данная технология обладает большим потенциалом для интеграции в рулонную технологическую линию производства высокоэффективных гибких СКСЭ.

Результаты получены с использованием оборудования Научно-образовательного центра "Лазерные технологии", Центра коллективного пользования и Научнообразовательного центра "Нанотехнологии", Института нанотехнологий, электроники и приборостроения Южного федерального университета (г. Таганрог).

Статья написана в рамках выполнения проекта ФЦП России № 14.587.21.0025. Уникальный идентификатор проекта RFMEFI58716X0025.

#### Список литературы

- Choonghoe Kim, Seongsu Kim, Myeongkyu Lee. Appl. Surf. Sci., 270, 462 (2013).
- [2] D. Shahrjerdi, S.W. Bedell, C. Bayram, C. Lubguban, K. Fogel, P. Lauro, J. Ott, M. Hopstaken, M. Gayness, D. Sadana. Adv. Energy Mater., 3, 566 (2013).
- [3] A. Hagfeldt, G. Boschloo, L. Sun, L. Kloo, H. Pettersson. Chem. Rev., **110**, 6595 (2010).
- [4] Liqun Ming, Huan Yang, Wenjun Zhang, Xianwei Zeng, Dehua Xiong, Zhen Xu, Huan Wang, Wei Chen, Xiaobao Xu, Mingkui Wang, Jun Duan, Yi-Bing Cheng, Jie Zhang, Qiaoliang Bao, Zhanhua Wei, Shihe Yang. J. Mater. Chem. A, 2, 4566 (2014).

- [5] Jinsoo Lee, Junghwan Yoon, Minhea Jin, Myeongkyu Lee. J. Appl. Phys., **112**, 043 110 (2012).
- [6] Junghwan Yoon, Minhea Jin, Myeongkyu Lee. Adv. Mater., 23, 3974 (2011).
- [7] Th. Dittricha, A. Ofir, S. Tirosh, L. Grinis, A. Zaban. Appl. Phys. Lett., 88, 182 110 (2006).
- [8] Ashi Ofir, Snir Dor, L. Grinis, A. Zaban, T. Dittrich, J. Bisquert. J. Chem. Phys., **128**, 064 703 (2008).
- [9] R.M. Pasquarelli, D.S. Ginley, R. O'Hayre. Chem. Soc. Rev., 40, 5406 (2011).
- [10] Jonghyun Kim, Jinsoo Kim, Myeongkyu Lee. Surf. Coat. Technol., 205, 372 (2010).
- [11] H. Kim, R.C.Y. Auyeung, M. Ollinger, G.P. Kushto, Z.H. Kafafi, A. Piqu. Appl. Phys. A, 83, 73 (2006).
- [12] G. Mincuzzi, L. Vesce, A. Reale, A. Di Carlo, T. M. Brown. Appl. Phys. Lett., 95, 103 312 (2009).
- [13] S.P. Malyukov, A.V. Sayenko. J. Russian Laser Res., 34, 531 (2013).
- [14] G. Mincuzzi, M. Schulz-Ruhtenberg, L. Vesce1, A. Reale, A. Di Carlo, A. Gillner, T.M. Brown. Progr. Photovolt. Res. Appl., 22, 308 (2014).
- [15] S.P. Malyukov, A.V. Sayenko, I.V. Kulikova, Yu.V. Klunnikova. J. Phys.: Conf. Ser., 541, 012 060 (2014).
- [16] С.П. Малюков, А.В. Саенко. Изв. ЮФУ. Техн. науки, 1, 120 (2014).
- [17] Linyun Liang, Songyuan Dai, Linhua Hu, Fantai Kong, Weiwei Xu, Kongjia Wang. J. Phys. Chem. B, **110**, 12404 (2006).
- [18] М.А. Пугачевский. Письма ЖТФ, 38 (7), 56 (2012).
- [19] Ming-Yi Pu, Jian Z. Chen. Mater. Lett., 66, 162 (2012).

Редактор Г.А. Оганесян

## Laser sintering of TiO<sub>2</sub> nanoporous film on the flexible substrate for solar cells application

S.P. Malyukov, A.V. Sayenko, I.A. Kirichenko

Institute of nanotechnologies, electronics and equipment engineering Southern Federal University, 347928 Taganrog, Russia

**Abstract** The article discusses the selective laser sintering of  $TiO_2$  nanoparticle film on plastic conductive substrate for flexible dye-sensitized solar cells applications. It is shown that laser sintering the absorbed laser energy helps to create an electrical contact between the  $TiO_2$  nanoparticles, without damage the plastic conductive substrate. The choice of the near-infrared laser source (wavelength 1064 nm) causes the efficiency of the laser sintering process. The method of laser sintering contribute to reduce recombination losses in the  $TiO_2$  film and to improve charge collection efficiency that may increase solar conversion efficiency. In addition, an effective method of laser sintering has great potential for use in roll-to-roll manufacturing of highly efficient flexible solar cells.